

GGK-RF15.

Il generatore RF a 13,56 MHz più compatto e affidabile della sua categoria, pronto a salire a bordo camera dove lo spazio è prezioso.



13,56 MHz

Frequenza, al quarzo

200 W

Potenza, passo 1 W

85 %

Efficienza stadio out

2,5 kg

Peso, ultracompatto

Potenza RF affidabile, nel minimo ingombro

Il **GGK-RF15** è un generatore RF nella banda ISM a 13,56 MHz, con potenza regolabile da 0 a 200 W. Nato dalla profonda esperienza Gambetti nel plasma e nelle tecnologie del vuoto, è il generatore più **compatto e affidabile** della sua categoria, proposto a un prezzo estremamente interessante.

L'elevata affidabilità e la compattezza nascono dalla selezione di componenti di ultima generazione già in fase di progetto. Il risultato è un apparato costruito con un **numero ridotto di parti** e quasi totalmente privo di cablaggi interni.

Le dimensioni estremamente ridotte permettono di montare il generatore **direttamente a bordo camera**, ideale nei piccoli sistemi al plasma dove ogni centimetro conta.



Chassis ultracompatto in acciaio con LED di stato e allarme.

Ultracompatto

220 × 180 × 80 mm per soli 2,5 kg: si monta ovunque, anche a bordo camera.

Stabilizzato al quarzo

13,56 MHz, 200 W fondo scala con regolazione a passo di 1 W.

Efficienza 85%

Lo stadio di uscita converte la DC in RF con poche perdite: raffreddamento minimo.

Pochi componenti

Quasi nessun cablaggio interno: meno punti di guasto, più affidabilità.

ROBUSTEZZA TOTALE

Costruito per non fermarsi mai

Protezione d'uscita completa

Lavora senza guasti su qualsiasi carico, anche corto circuito o circuito aperto, per un tempo illimitato. Il limite di potenza riflessa è di 50 W: la soluzione ideale in abbinamento alle reti di adattamento.

Ventola intelligente

Raffreddamento ad aria con ventola interna da 50 mm, attivata solo quando l'uscita RF è attiva. Un dettaglio che allunga sensibilmente la vita della ventola e del generatore.

Compatto. Efficiente. Inarrestabile.

Dove lavora il GGK-RF15

- **Trattamenti al plasma** per modifica, attivazione e pre-pulizia delle superfici.
- **Etching** e processi di Reactive Ion Etching.
- **Alimentazione** di piccoli catodi di sputtering.
- **Deposizione** assistita da plasma PECVD.
- **Montaggio a bordo camera** nei piccoli sistemi al plasma.
- **Abbinamento** ideale alle reti di adattamento Gambetti.

CAMPI DI IMPIEGO

RIEReactive
Ion
Etching**PVD**Rivestimenti
PVD**PECVD**Plasma-
Enhanced
CVD**R&D**Ricerca
e
sviluppo

Specifiche

DIMENSIONI

Ingombro	220 × 180 × 80 mm
Peso	2,5 kg

RADIOFREQUENZA

Frequenza	13,56 MHz al quarzo
Potenza	200 W f.s., passo 1 W
Tolleranza	< 3% f.s. su 50 Ω

STADIO DI USCITA

Efficienza DC-RF	85%
Protezione	Carico illimitato
Corto / aperto	Sicuro, illimitato
Limite pot. riflessa	50 W

INTERFACCIA UTENTE

Connettore	D-Type 15 pin
Segnali analogici	10 V f.s.
Lecture	Setpoint, FWD, REV
Segnali digitali	24 V standard
Allarmi	Disponibili

RAFFREDDAMENTO

Tipo	Aria, ventola 50 mm
Attivazione	Solo con RF attiva

CONFORMITÀ

Certificazione	CE Marked
----------------	-----------